



PROGRAMA - 6º SEMINÁRIO ABRAFATI-RADTECH DE CURA POR RADIAÇÃO

PROGRAM - 6th RADTECH SOUTH AMERICA SEMINAR

01 de outubro / October 01st

15:15 - 15:45	Abertura / Opening - Antonio Carlos de Oliveira - Presidente Executivo / Executive President - ABRAFATI
15:20 - 15:45	Painel
	Br - USA - Europe - China
15:45 - 16:15	101 Jonathan Shaw Allnex Energia de Cura para Aplicações em Metal <i>Energy Curing for Metal Applications</i>
16:15 - 16:30	<i>coffee break</i>
16:30 - 17:00	37 Chakrapani Srinivasan, Stephen Postle, Gabriele Norcini, Elena Bellotti, Gianni Casaluce, Angelo Casiraghi, Marika Morone IGM Resins Fotoiniciadores em um Mundo Base Água <i>Photoinitiators in a Waterborne World</i>
17:00 - 17:30	166 Roberto Caforio Weilburger Brasil Desafios e Soluções para Acabamentos Foscos de Cura por Radiação na Indústria Gráfica <i>Challenges and Solutions for Radiation-Cured Finishes in the Printing Industry</i>
17:30 - 18:00	26 Steve Broadwater, Adrielle Guedes, Carlos Bravo Grace Soluções para Fosqueamento em Sistemas de Cura por Radiação <i>Solutions for Matting in Radiation-Curing Systems</i>



PROGRAMA - 6º SEMINÁRIO ABRAFATI-RADTECH DE CURA POR RADIAÇÃO

PROGRAM - 6th RADTECH SOUTH AMERICA SEMINAR

02 de outubro / October 02nd

15:15 - 15:45	82 Ingrid Meyer, Jason Ghaderi, Xiangtao Meng Evonik Novo Aditivo de Controle de Superfície com Ampla Conformidade de Contato com Alimentos: Benefícios em Tintas de Impressão (Cura UV) e Vernizes de Sobreimpressão <i>A New Surface Control Additive with Broad Food Contact Compliances: Performance Benefits in Radiation-Cured Inks and Overprint Varnishes</i>
15:45 - 16:15	115 Srinivasan Chakrapani, Camila Baroni, Curt Lustig IGM Resins USA Revestimentos UV - Opções para Substratos Desafiadores <i>UV Coatings - Options for Challenging Substrates</i>
16:15 - 16:30	<i>coffee break</i>
16:30 - 17:00	96 Jo Ann Arceneaux, Celia Buono, Kevin Poelmans, Tong Wang Allnex Uso de Amino Acriladas para Reduzir a Concentração de Fotoiniciador ou Aumentar a Velocidade de Cura em OPVs e Tintas Flexo curáveis por UV LED <i>Use of Amino Acrylates to Reduce Photoinitiator Concentration or Increase Cure Speed in UV LED Curable OPVs and Flexo Inks</i>
17:00 - 17:30	43 Steven Tsai, Yuan-Qi Tian, Shiu-Fan Wang, Hung-An Ho Qualipoly Chemical Esmaltes de Cura UV de Alto Desempenho para Revestimentos de Metais <i>High Performance UV-Cured Enamels for Metal Coatings</i>
17:30 - 18:00	120 Kevin Joesel Heraeus Noblelight Tecnologia UV LED <i>LED UV Technology</i>



PROGRAMA - 6º SEMINÁRIO ABRAFATI-RADTECH DE CURA POR RADIAÇÃO

PROGRAM - 6th RADTECH SOUTH AMERICA SEMINAR

03 de outubro / October 03rd

15:15 às 15:45	165 Sergio Medeiros BRChemical Radiometria: Controle do Processo de Cura por UV <i>Radiometry: Control of the UV Curing Process</i>
15:45 às 16:15	99 Steven Cappelle, Marcus Hutchins Allnex Tecnologia de Dupla Cura para Plásticos <i>Dual Curing Technology for Plastics</i>
16:15 às 16:30	<i>coffee break</i>
16:30 - 17:00	5 RJ Viereckl, Michael Gould, Volker Petry, Rich Dodd, Xavier Marguerettaz, Sean Des Roches Rahn Formulando para Impressão 3D (SLA) <i>Formulating for 3D Printing (SLA)</i>
17:00 - 17:30	119 Kevin Joesel Heraeus Noblelight Tecnologia em Cura por UV <i>UV Curing Technology</i>
17:30 - 18:00	126 Gisele Marschner Rasia, Luciana Rocha Santos, Jônatas Faleiro Berbigier, Carmem Rosane Isse Gomes, Maristela C.F. Ramos de Oliveira, Rodolfo de Camargo Aranha, Isabella Marini Vargas, Gisele Garcia do Nascimento, Tatiana Fernanda Fernandes Cortez, Fábio Rodrigues Costa, José Victor Voltarel SENAI Inovação em Eng. De Polímeros Influência da Adição de Retardantes de Chama do Tipo Fosfato no Desempenho de um Verniz de Cura UV <i>Influence of the Addition of Phosphate-Based Flame Retardants in the Performance of a UV-Curing Varnish</i>